

合金靶材

合金靶材是由两种或多种金属元素组成的溅射镀膜材料，通过物理气相沉积(PVD)工艺在基材表面形成合金薄膜，主要特征包括高纯度、高均匀性、大尺寸和复杂结构，制备工艺主要包括原材料提纯、合金化熔炼、铸造、锻造、轧制、热处理和机械加工。主要应用于半导体、平面显示、太阳能电池、磁光存储介质等领域。其核心制备工艺包括真空熔炼、粉末冶金、等离子喷涂等，典型产品包含镍铬合金、钛铝合金、铜铟镓硒合金等类型。产品纯度通常达到 99.95%至 99.9999%，需匹配磁控溅射、脉冲激光沉积等技术对晶粒尺寸、电阻率等性能指标的要求。

材料	纯度	最大尺寸	制备方法	备注
Al-Cu	4N~5N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Al-Ti	4N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Al-Mg	4N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Ag-Cu	4N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Co-Cr	3N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Co-Ni	3N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Co-Fe	3N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Co-Fe-B	3N	300×300mm	特殊烧结	厚度根据要求定制
Co-Fe-Cu	3N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Cr-Si	3N	300×300mm	特殊烧结	厚度根据要求定制
Cu-Mn	3N~3N5	Dia100mm	特殊烧结	厚度根据要求定制
Cu-Mn	3N~3N5	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Cu-Al	3N~4N	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Fe-Mn	2N5	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
Fe-Ni	2N5~3N5	300×300mm	熔炼	厚度根据要求定制
FeCoBSi	2N5	Dia100mm	特殊烧结	厚度根据要求定制
.....				